

曝光機

- ORC 手動 5KW 平行曝光機 EXM-1201-F
- ORC 手動 5KW 曝光機 HMW-201B-5K
- ORC 手動 7KW 曝光機 HWM-680-GW
- ORC SOLDER MASK 自動曝光機 Model:EXP-2001B
- ORC 外層自動曝光機 Model:EXP-2050
- ORC 內層乾膜 5KW 平行自動曝光機 Model:EXM-2010-B-A
- ORC 內層濕膜 7KW 散射光自動曝光機 Model:EXM-2010-B-S
- ORC 外層半自動 CCD 自動對位曝光機 Model:EXP-2951
- ORC 防焊半自動 CCD 對位曝光機 Model:EXP-2950
- ORC 1,2,3,4,6 分割露光裝置 外層/綠漆 Model:EXP-2021
- ORC 垂直式投影露光裝置 Model:EXP-2330

ORC 5KW 平行光手動曝光機 EXM-1201-F

特性簡介：

1. 適用於乾膜細線路曝光用。
2. 平行光光源，平行半角 2.5° ，傾斜角 2.5° 實現高解析度。
3. 採用雙框，兩面一次曝光，產能高。
4. 採用 ORC 專利之能量控制器，實現高穩定之曝光。
5. 使用單燈，兩面曝光，生產成本較低。



ORC 手動 5KW HMW-201B-5K 曝光機

特性簡介：

1. 採用 5KW 燈管，適用於乾膜線路曝光之曝光機。
2. 採用雙框、雙面同時曝光系統及高均勻度反射罩，實現高解析度及高信賴度之生產

品質。

3. 有效曝光面積 24"x32"。
4. 全機封閉式設計，不會影響工作環境。
5. 上下燈共有八組獨立之能量控制。適用於多種不同乾膜能量之設定。
6. 採用 ORC 專利之能量控制器，確保高穩定性信賴度之生產良率。



ORC 手動 7KW HMW-680-GW 曝光機

特性簡介：

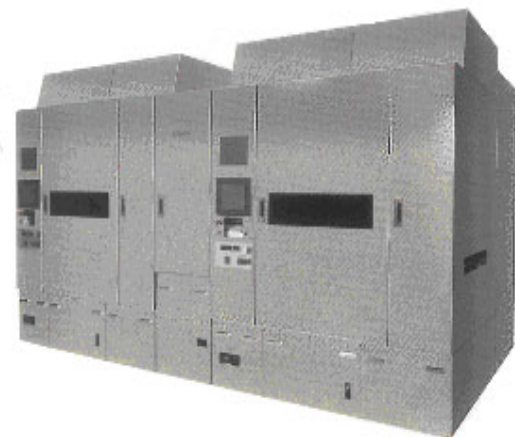
1. 採用 7KW 高照度燈管，適用於乾膜防焊及溼膜防焊油墨之曝光使用。
2. 採用雙框、雙面同時曝光系統，及高照度燈管高反射率反射罩，實現高照度 30mw/cm² 以上，高均勻度 80%以上高產能之要求。
3. 有效曝光面積 24"x32"。
4. 高效率冷凍系統設計，內建恆溫控制器，不斷偵測曝光室溫度變化，藉由 PLC 控制，達到恆溫控制維持曝光室、曝光檯面之溫度，確保底片即板子不受溫度變化影響，提高生產良率。
5. 全機封閉式設計，確保不會影響工作環境。
6. 以下燈共有八組獨立的能量控制，適用於多種不同油墨及能量之設定。
7. 具 ORC 專利之能量控制器，確保高穩定性、高信賴度之生產良率。



ORC SOLDER MASK 自動曝光機 Model: EXP-2001B

特性簡介：

1. 高照度、高產能。利用高反射率反射鏡、光學玻璃 10KW 燈管。
2. 高對位精度。利用 CCD 對位系統，實現對位精度 $\pm 10\mu\text{m}$ 。
3. 高良率設計。利用 CCD 對位系統。實現曝光前對位精度確認，實現 100%對位曝光良率之保證。
4. 實現完全自動化設計。可外接投板機收板機及其他製程完全連線搭配。
5. 恆溫控制。具曝光玻璃及板溫控制系統，減少油墨軟化之不良產生。實現高安定性之曝光環境。
6. 實現低成本高效率生產。採用高透光性光學玻璃，實現低成本之生產效率。
7. 操作簡易。採用 LCD TOUCH PANEL，內建中文對答式操作系統，實現高效率簡易操作。



ORC 外層自動曝光機 Model EXP-2050

特性簡介：

1. 高解析度。利用平行光，可實行線寬線距 60um 之解析度。
2. 高照度、高產能。最大產量 19secs/pnl。
3. 高對位精度。利用 CCD 對位系統，實現對位精度 $\pm 10\mu\text{m}$ 。
4. 高良率設計。利用 CCD 對位系統。實現曝光前對位精度確認，實現 100%對位曝光良率之保證。
5. 實現完全自動化設計。可外接投板機及收板機。
6. 恆溫控制。並可加裝恆溫控制及自動底片清潔裝置，HAPA 空氣濾清系統，提高高穩定性，信賴性的曝光工作環境。
7. 機台體積小，不佔空間。
8. 單燈雙框公用系統，提高光源使用率至 96%以上，減少生產成本。
9. 利用高反射率反射鏡，實現高平行度之平行光。
10. 操作簡易。採用 LCD TOUCH PANEL，內建中文對答式操作系統，實現高效率簡易操作。



ORC 內層乾膜自動曝光機 5KW 平行光 5KW EXM-2010-BA

ORC 內層濕膜自動曝光機散射光 7KW EXM-2010-BS



ORC 外層半 CCD 自動曝光機 EXP-2951

ORC 防焊半 CCD 自動曝光機 EXP-2950

